

ICF与激光等离子体

空腔Cu靶的化学镀制备方法及其特性

[刘继光¹](#) [万小波²](#) [付渠¹](#) [周兰²](#) [宋红文¹](#) [肖江²](#)

(1. 西南科技大学 制造学院, 四川 绵阳 621010; 2. 中国工程物理研究院 激光聚变研究中心, 四川 绵阳 621900)

摘要: 在预处理芯轴(基体)表面金属的催化作用下, 通过镀液可控制的还原反应在芯轴表面不断产生金属Cu的化学沉积, 然后刻蚀掉芯轴, 经Cu层表面钝化处理而得到空腔Cu靶。对Cu靶的表面形貌、孔隙率、厚度及其均匀性、Cu靶纯度、抗氧化性能等进行了测试与分析, 实验结果表明, 所测各项数据达到Cu靶ICF应用的性能指标。化学镀方法为制备其它金属或合金空腔靶提供了新的途径。

关键词: [惯性约束聚变\(ICF\)](#) [空腔靶](#) [化学镀Cu](#) [抗氧化处理](#)

通信作者:

相关文章([惯性约束聚变\(ICF\)](#)):

[空腔Cu靶的化学镀制备方法及其特性](#)

[高钾空心玻璃微球的制备](#)

[多辊轧机冷轧技术在靶材料制备中的应用](#)

[\[PDF全文\]](#)

[\[HTML摘要\]](#)

[发表评论](#)

[查看评论](#)